



2019年5月28日

各位

会社名 株式会社フジインコーポレーテッド
代表者名 代表取締役社長 関 敬 史
(コード番号 5384 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役財務本部長 鈴木 彰
(TEL 052-503-8181)

株式会社FLOSFIA(フロスフィア)への出資に関するお知らせ

株式会社フジインコーポレーテッド(本社:愛知県清須市、代表取締役社長:関 敬史、以下「フジミ」)は、株式会社 FLOSFIA(本社:京都府京都市、代表取締役社長:人羅俊実、以下「FLOSFIA」)が発行するシリーズDラウンド第二弾の新株を引き受けることといたしました。あわせて、フジミが2015年11月に設立したフェニックス投資事業有限責任組合(本社:京都府京都市、代表取締役社長:松本直人、以下「フェニックスファンド」)もこの度のFLOSFIA発行の新株を引き受けております。なお、フェニックスファンドによるFLOSFIAの発行する新株引受は2017年3月に続き2度目となります。

FLOSFIAは京都大学発のベンチャー企業として、世界に先駆けて α -Ga₂O₃(酸化ガリウム)パワー半導体の事業化に取り組んでおり、GaO®シリーズとしてサンプル出荷を開始しています。

今回FLOSFIAが行う資金調達は、同社が目指す価値「グリーン且つクリーンな技術を用いて人類の進歩に貢献すること」を実現するための戦略的パートナーシップ構築と長期成長に向けた基盤づくりを目的とするもので、これを機に、2019年中のSBD(ショットキーバリアダイオード)量産体制構築、その後のFET(電界効果トランジスタ)のサンプル出荷・量産化を加速させ、より幅広い産業領域への展開を進めるものです。さらに、GaO®デバイスの早い応答性、小さなオン抵抗値等により、電源・車載・動力領域でのイノベーションの実現、ミストドライ®法を利用した新規材料の事業化を加速させるとともに、機器の電動化、小型化、損失低減等を通じて持続可能な社会の実現に貢献するものです。

フジミは、本出資とあわせ、保有する精密研磨加工技術および精密洗浄技術をFLOSFIAの α -Ga₂O₃パワー半導体への適用を目指すとともに、戦略的パートナーとして協業を進めてまいります。

※「GaO®」及び「ミストドライ®」はFLOSFIAの登録商標です。

FLOSFIAの会社概要

会社名	株式会社 FLOSFIA(フロスフィア)
所在地	京都市西京区御陵大原1番29号
代表取締役社長	人羅俊実
資本金	2,910百万円(資本準備金含む)
事業内容	酸化ガリウム系パワーデバイスの研究・製造・販売(パワーデバイス事業) 各種金属酸化膜等の受託成膜、コーティング(成膜ソリューション事業)

フェニックスファンドの概要

名称	フェニックス投資事業有限責任組合
出資総額	300百万円
運用期間	2024年12月31日まで(2年を超えない範囲で延長有)
運用者	フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
投資対象	当社と連携の可能性の高い未上場企業

なお、本件が2020年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上